20a-E2-9

## Si0<sub>2</sub>/Si 上グラフェンナノリボンの大規模第一原理電子伝導計算

Large-scale first-principles electronic transport calculations of graphene nanoribbons

## on SiO<sub>2</sub>/Si 富士通研<sup>1</sup>, 北陸先端大<sup>2</sup> <sup>0</sup>實宝 秀幸<sup>1</sup>, 尾崎 泰助<sup>2</sup>, 大淵 真理<sup>1</sup> Fujitsu Laboratories Ltd.<sup>1</sup>, JAIST<sup>2</sup> <sup>°</sup>Hideyuki Jippo<sup>1</sup>, Taisuke Ozaki<sup>2</sup>, Mari Ohfuchi<sup>1</sup> E-mail: jippo.hideyuki@jp.fujitsu.com

グラフェンは、電子デバイス中では通常 SiO<sub>2</sub>などの絶縁膜上に担持され、孤立グラフェンとは 著しく異なる電気特性を示す[1,2]。我々はこれまでに、2000 原子程度からなるチャネル長 9.91nm の SiO<sub>2</sub>/Si 上グラフェンナノリボンの大規模第一原理電子伝導計算を実施し、SiO<sub>2</sub>/Si 上では電流 のオンオフ比が孤立グラフェンより 10<sup>8</sup> 程度小さくなることを示した[3]。今回、さらに大規模な 3000 原子程度からなる 15.1nm の長いチャネル長の場合を計算し、チャネル長 9.91nm の場合との 電子伝導特性の比較を行った。

計算に用いた構造モデルを図 1 に示す。約 1.6eV の バンドギャップを持つ幅 0.7nm のアームチェア型グラ フェンナノリボン (AGNR) のチャネルが、半無限の 金属 AGNR リードで挟まれている。チャネル部分はそ れぞれ厚さ 0.45nm、0.40nm の SiO<sub>2</sub>/Si に接している。 計算には、第一原理計算コード OpenMX[4]を用いた。

9.91nm と 15.1nm の両方のチャネル長について、非 平衡グリーン関数法で求めたバイアス電圧がゼロの場 合の透過率から見積もった電流値を図 2 に示す。ソー ス・ドレイン電圧が 0.5V の場合を模し、横軸のエネル ギーを中心に 0.5eV の範囲で透過率を積分して電流を 求めた。横軸はバックゲート電圧印加時の AGNR にか かる電圧と見なせる。SiO<sub>2</sub>/Si 上 AGNR では、電流のオ フ領域が約 0.7eV シフトし、p 型伝導を示すことが分か





図 2. チャネル長 9.91nm (実線)、15.1nm (点線)の場合の(a)(c)SiO<sub>2</sub>/Si 上 AGNR、 (b)(d)孤立 AGNR の電流値。

る。オン電流にチャネル長依存性はないが、孤立 AGNR では長いチャネル長でオンオフ比が 10<sup>7</sup> 大きくなるのに対し、SiO<sub>2</sub>/Si 上 AGNR では 10<sup>5</sup> から変化しない。これは、SiO<sub>2</sub>/Si との相互作用に よる透過率ギャップ中への状態の染み出しがオフ電流を決定するためであると考えられる。オン オフ比 10<sup>5</sup> という値は、チャネル長は異なる(210nm)ものの、SiO<sub>2</sub> 上 GNR の実験結果[1]と一致 している。このように、大規模計算を実現することで、将来のナノデバイスにおける環境との相 互作用を含んだより現実的な電気伝導特性の予測が可能となった。

[1] X. Li *et al.*, Science 319, 1229 (2008). [2] M.-W. Lin *et al.*, Nanotechnology 22, 265201 (2011).
[3] H. Jippo *et al.*, Appl. Phys. Express, to be published. [4] http://www.openmx-square.org/